

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 1 区分

【発行日】平成20年7月3日(2008.7.3)

【公開番号】特開2005-338076(P2005-338076A)

【公開日】平成17年12月8日(2005.12.8)

【年通号数】公開・登録公報2005-048

【出願番号】特願2005-144359(P2005-144359)

【国際特許分類】

G 0 1 B 9/02 (2006.01)

G 0 2 B 5/04 (2006.01)

G 0 1 V 8/14 (2006.01)

【F I】

G 0 1 B 9/02

G 0 2 B 5/04 D

G 0 1 V 9/04 C

【手続補正書】

【提出日】平成20年5月19日(2008.5.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の偏光成分および第 2 の偏光成分を含む第 1 の入力ビームの発生源 ( 2 1 0 ) と、前記第 1 の偏光成分と前記第 2 の偏光成分とを分離するように配置された偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) と、

前記第 1 の偏光成分と前記第 2 の偏光成分を再結合させる前に、前記第 1 の偏光成分を反射させるように配置された第 1 の偏光操作レトロリフレクタ ( 2 3 0 ) と、  
からなる干渉計システム。

【請求項 2】

前記第 1 の偏光成分と前記第 2 の偏光成分を再結合させる前に、前記第 2 の偏光成分を反射させるように配置された第 2 の偏光操作レトロリフレクタ ( 2 4 0 ) を更に含む、請求項 1 に記載の干渉計システム。

【請求項 3】

第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) と、  
前記第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) と前記偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) との間に配置された 1 / 4 波長板 ( 3 2 0 ) と

をさらに含み、前記偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) からの前記第 2 の偏光成分は、前記第 2 の偏光操作レトロリフレクタ ( 3 5 0 ) で反射される前と、前記第 2 の偏光操作レトロリフレクタ ( 3 5 0 ) で反射された後に、一回ずつ前記第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) で反射される、請求項 2 に記載の干渉計システム。

【請求項 4】

前記第 1 の偏光成分の経路上に第 2 の平面反射器 ( 8 3 0 ) をさらに含み、前記 1 / 4 波長板 ( 3 2 0 ) が、前記偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) と前記第 2 の平面反射器 ( 8 3 0 ) との間に配置され、

前記第 1 の偏光成分の経路上且つ前記第 2 の偏光成分の経路上に偏光変換レトロリフレクタ ( 8 6 0 ) をさらに含む、請求項 3 に記載の干渉計システム。

## 【請求項 5】

第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) と、

前記第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) と前記偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) との間に配置された第 1 の  $1/4$  波長板 ( 3 2 0 ) であって、該第 1 の  $1/4$  波長板 ( 3 2 0 ) と前記第 1 の平面反射器 ( 3 4 0 ) が前記第 1 の偏光成分の経路上に配置される、第 1 の  $1/4$  波長板 ( 3 2 0 ) と、

第 2 の平面反射器 ( 4 3 0 ) と、

前記第 2 の平面反射器 ( 4 3 0 ) と前記偏光ビームスプリッタ ( 2 2 0 ) との間に配置された第 2 の  $1/4$  波長板 ( 4 2 0 ) であって、該第 2 の  $1/4$  波長板 ( 4 2 0 ) と前記第 2 の平面反射器 ( 4 3 0 ) が前記第 2 の偏光成分の経路上に配置される、第 2 の  $1/4$  波長板 ( 4 2 0 ) と、

をさらに含む、請求項 1 に記載の干渉計システム。